

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成22年11月25日(2010.11.25)

【公表番号】特表2007-524555(P2007-524555A)

【公表日】平成19年8月30日(2007.8.30)

【年通号数】公開・登録公報2007-033

【出願番号】特願2006-503477(P2006-503477)

【国際特許分類】

C 01 B 33/193 (2006.01)

A 61 K 8/25 (2006.01)

A 61 K 8/49 (2006.01)

A 61 Q 11/00 (2006.01)

【F I】

C 01 B 33/193

A 61 K 8/25

A 61 K 8/49

A 61 Q 11/00

【誤訳訂正書】

【提出日】平成22年10月8日(2010.10.8)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項23

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項23】

沈降シリカ生成物の製造方法であって：

a) 中央径が1~100μmの非晶質シリカ支持体粒子を提供すること：

b) 該非晶質シリカ支持体粒子が分散している水性媒体中で、アルカリ金属ケイ酸塩を酸性化することによって、シリカ支持体粒子の表面上に活性シリカを堆積させること、を含み、ここで、前記活性シリカは、約500より大きい直径を有する全ての孔に関して8m<sup>2</sup>/g未満(水銀圧入法によって測定)の累積表面積、及び約55%より大きい百分率塩化セチルピリジニウム(%CPC)適合性を有する、多孔質表面を有するシリカ粒子のスラリーを提供するのに有効な量で堆積させる、前記方法。